

過酸化水素の直接合成反応シミュレーション

1. はじめに

 $H_2 \ge O_2$ からの直接  $H_2O_2$ 合成は、シンプ ルケミストリーの立場から二重に興味深い テーマである。第一に  $H_2O_2$ がクリーンな酸 化剤として有用であり、第二にはその合成 反応式が極めてシンプルであるからである。 他方、 $H_2 \ge O_2$ の反応(通常、 $H_2O$ が生成)は 最も基本的な反応のひとつであり、触媒反 応の理論的観点からも興味深い。

定年を迎え、もう一度実験をして見たい と思ったときに選んだのはこのテーマであ った。2001年当時、多くの特許が出ていた が工業化に成功した例がなかった。何が問 題なのかが非常に興味を引いたのである。 それを解決すれば工業化できるかもしれな い・・・、このような期待もあった。東工 大資源化学研究所の岩本先生の下で研究を 始めた。

### 2. 動力学の困難性

特許からの技術評価は不可能であった。 動力学が皆無であったためである。この合成反応では Fig. 1 に示すように併発および 逐次の副反応により  $H_2O$  が副生する。特許 の実施例では多くの場合  $H_2$ の反応率と得 られた  $H_2O_2$ の選択率が記載されるだけで



元住友化学(株) 出口 隆

併発および逐次反応が分離されていない。 この分離がないと反応の進行とともに H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>選択率がどのように変化するか予測が つかない。両副反応の生成物が同じという ことが解析を難しくしている。

もう一つの困難は、反応系が気-液-固 の3相で、ガスの物質移動の制約を受ける ことである。このために学術文献でも動力 学的検討が難しいとされていた。

#### 3. 触媒の概要

主反応は O2 の選択的水素化ともいうべ きもので、有効な触媒はPd が中心となって いる。反応の原理は1世紀も前に特許とし て現れているが、企業の研究開発が特に盛 んになったのは du Pont 社の特許[1]で Pd 触 媒に酸と Brイオンを組み合わせた系が有 効であることが公表された 1988 年以降で ある。その後、学術的研究も盛んになり、 Pd-Au 合金系が有効であることが見出され ている[2]。ところで、PdはH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>分解反応(→ H<sub>2</sub>O + 1/2O<sub>2</sub>)の触媒としても高活性であり、 添加物がない場合にはよほど触媒量を少な くしないと反応の追跡が難しいくらい分解 が速く進む。このような触媒が合成触媒と して有効であるというのは触媒化学の不思 議といってもよい。

# 4. ガスの物質移動を考慮した動力学

ガスの物質移動を含む反応の動力学は反応工学の教科書的知識の応用である。通常、 $O_2$ 大過剰の条件で反応を行うので、 $H_2$ の物質移動のみを考慮した。Fig. 2 に示すとおり、気相の  $H_2$  分圧を  $p_{H2}$ 、これに平衡な液相 $H_2$ 濃度を  $c^*$  (=  $p_{H2}/H$ ; H はヘンリー定数)



Fig. 2. H<sub>2</sub>の溶解現象.

とおき、 $H_2$ の反応速度  $r_0$ が液中の  $H_2$ 濃度 cの1次に比例すると仮定すれば、次式が 得られる。ここに、 $k_La$ は  $H_2$ の物質移動係 数、kは反応速度定数である。

 $r_0 = k_L a(c^* - c) = k c[Cat]$  (1) 一方、見かけの反応速度定数を  $k_{0a}$  とすれば、

 $r_0 = k_{0a} p_{H2}$ [Cat] (2) であり、これらの式を整理すると(3)式が導 かれ、また液中 H<sub>2</sub> 濃度は(4)式で計算され る。ここに  $k_0$  (= k/H)は真の速度定数である。

 $1/k_{0a} = 1/k_0 + [Cat]/(k_L a/H)$ (3)  $c = p_{H2}/H - r_0/k_L a$ (4)

Fig. 3には 5%-Pd/C 触媒による  $H_2O_2$ の水 素化反応( $p_{H2}$ の1次、[ $H_2O_2$ ]の0次反応)に おける  $1/k_{0a}$ と[Cat]の関係を示す。図による と、 $k_0$ は撹拌速度によらず一定となり、  $k_La$ は撹拌速度とともに大きくなるこ とが判る。 $k_La$ は流体の性状と反応器の 形状、撹拌速度など装置特性によって 決まる定数であるから、この値をあら かじめ求めておけば(3)式から $k_0$ を求め ることができる。また(4)式を用いて、 反応緒元と液中水素濃度の関係を知る ことができる。反応実験は 300ml フラ スコを用い、マグネティックスターラ 一の回転速度を 1350 rpm としたが、こ のときの  $k_La$ は 560 h<sup>-1</sup> であった。

## 5. 併発および逐次の副反応の分離

 $H_2O_2$ の損失速度は $[H_2O_2]$ と[Cat]に比例すると仮定すれば(5)式が得られる。ここに  $S_f$ は $H_2O_2$ の生成選択率、 $k_d$ は $H_2O_2$ 



Fig. 3. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 水素化における触媒濃度と 1/k<sub>0a</sub>の関係. 触媒 5%-Pd/C, HBr 0.001 N, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 10-30 mmol L<sup>-1</sup>, p<sub>H2</sub> 7-10 kPa, 30 °C.

の損失速度定数である。反応の経時変化から(5)式に基づいて*S*<sub>f</sub>と*k*<sub>d</sub>を求めることができる。Fig. 4 に 5%-Pd/C 触媒による反応の経時変化の一例を示す。

 $d[H_2O_2]/dt = r_0S_f - k_d[H_2O_2][Cat]$  (5)

5%-Pd/C を触媒として反応の  $H_2$  および  $O_2$ の分圧依存性を調べたところ、反応は  $H_2$  の活性化律速であり、 $S_f$  は両方の分圧に依存せず、 $k_d$ は  $H_2$ 濃度に比例、 $O_2$ 分圧に反比例することが判った。

6. 実用反応条件での反応シミュレーション この反応の実用化に当たって最も重要な ことは爆発の防止である。H<sub>2</sub>-O<sub>2</sub>の混合系の 爆発範囲は H<sub>2</sub>が 4~75 %であるから気相



Fig. 4. H<sub>2</sub>-O<sub>2</sub> 反応経時変化の典型例. 5%-Pd/C 0.166 g L<sup>-1</sup> at HBr 0.001 N, *p*<sub>H2</sub> 7.6 kPa, *p*<sub>O2</sub> 15.7 kPa, 30 °C, and 1355 rpm.



Fig. 5. 触媒濃度の影響(ラボ撹拌条件).  $k_{L}a$  560 h<sup>-1</sup>,  $p_{H2}$  20 kPa, and  $p_{O2}$  200 kPa.

の  $H_2$  濃度を 2 %に設定し、 $O_2$  分圧を 200 kPa とした。全圧を 1 MPa とすれば  $p_{H2}$ は 20 kPa である。まずこの条件で、反応実験 で得られた  $k_L a$  の値を用いて反応のシミュ レーションを行った。結果を Fig. 5 に示す が、触媒濃度を高くしてもその効果が小さ くなり、満足な反応速度が得られないこと が判った。図中に示すとおり、触媒の効率  $r_0/r_0^*(r_0^*$ は反応律速の場合の反応速度)が 極端に小さくなっていく。これは実験で得 られた  $k_L a$  が小さすぎるためで、気液接触 を格段に改良する必要があることを示す。

そこで仮に  $k_L a = \infty$ としたときの反応経 時変化を計算した。Fig. 6 に示すとおり、触 媒濃度の増加に伴って反応速度が大きくな るが、 $H_2O_2$ の生成量が約 3.5 %までしか上 がらずに頭を打った。これは $k_d$ が大きすぎ るためであり、実用化のためにはその改善 が重要であることが判った。

## 7. 実用化性能の目標

濃縮コストを考えると実用化のためには 到達  $H_2O_2$ 濃度が 10 wt%は必要であろう。 また  $S_f$ は 100 %に近い成績が得られている ので、生成した  $H_2O_2$ の保持率を 80 %以上 にすることを目標とした。また生産性を考 えると数時間内で反応を終える必要がある。  $k_La$  と  $k_d$  を変えてケーススタディーを行っ た結果、Table 1 のような改善目標が得られ た[3]。 $p_{H2}$ は 50 kPa が必要で全圧は 2.5 MPa となる。炭化水素のリフォーミングで製造 される  $H_2$ の圧力は 1~3 MPa が普通である ので実用的に可能な範囲である。その上で



Fig. 6.  $k_{\rm L}a = \infty$ における触媒濃度の影響.  $p_{\rm H2}$  20 kPa and  $p_{\rm O2}$  200 kPa.

 $k_L a$  を実験室条件の1桁大きく、 $k_d$ を1桁小 さくする必要があることが判った。この $k_L a$ の値は工学的には不可能でないようだ。し かしそれだけ設備が複雑になり、エネルギ ーも多く必要とするから重要なコスト要因 にはなるだろう。なお、この条件でも触媒 の効率が 10 %程度に過ぎないことは、 $H_2$ の溶解抵抗の大きさを如実に示す。触媒的 にはいかに  $H_2O_2$ の分解(水素化)活性を低減 させるかが重要な課題である。

# Table 1. *k*<sub>L</sub>*a*、*k*<sub>d</sub>の目標例とそれによるプロ セス性能(5%-Pd/C 触媒基準).

[Cat] 10 g L<sup>-1</sup>, 全圧 2.5 Mpa, ガス組成 H<sub>2</sub> 2 vol%, O<sub>2</sub> 8 vol%.

因子	現状	目標	プロセス性能
$k_{\rm L}a~({\rm h}^{-1})$	560	5,000	H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 濃度 10 wt%
$k_{d0}$ *	100	14	所用反応時間 2.8 h
* 相対値; $k_d = k_{d0}c/p_{O2}$			STY 35 kg m <sup>-3</sup> h <sup>-1</sup> $r_0/r_0^* = 0.097$

#### 8. おわりに

直接法による H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> の合成は残念ながら まだ工業的に実施されていない。触媒と工 学の両方からのブレークスルーが必要と思 われるが、以上の検討結果が触媒とプロセ スの評価の一助になればよいと思っている。

[1] L.W. Gosser, et al. (du Pont), US Patent 4,772,458 (1988).

[2] 例えば T. Ishihara, et al., Chem. Lett. 36 (2007) 878.

[3] T. Deguchi, M. Iwamoto, Ind. Eng. Chem. Res.,50 (2011) 4351.